

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年8月24日(2006.8.24)

【公開番号】特開2000-39727(P2000-39727A)

【公開日】平成12年2月8日(2000.2.8)

【出願番号】特願平11-197523

【国際特許分類】

G 03 F 7/42 (2006.01)

H 01 L 21/027 (2006.01)

【F I】

G 03 F 7/42

H 01 L 21/30 5 7 2 B

【手続補正書】

【提出日】平成18年7月10日(2006.7.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

5～15重量%のアルカノールアミンと、

35～55重量%のスルホキシド化合物又はスルホン化合物と、

35～55重量%のグリコールエーテルとを含むことを特徴とするフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項2】

前記アルカノールアミンは、モノイソプロパノールアミン及びモノエタノールアミンからなる群より選択される少なくとも1つの化合物を含む請求項1に記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項3】

前記スルホキシド化合物は、ジメチルスルホキシド及びジエチルスルホキシドからなる群より選択される少なくとも1つの化合物を含み、前記スルホン化合物は、ジエチルスルホン及びジメチルスルホンからなる群より選択される少なくとも1つの化合物を含む請求項1又は2に記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

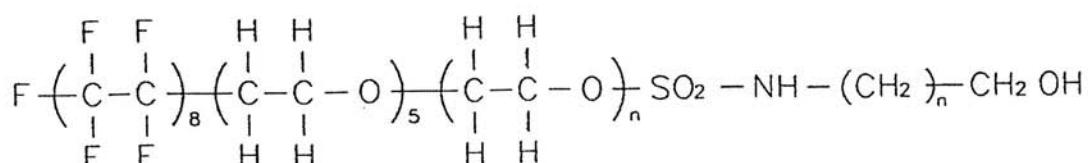
【請求項4】

前記グリコールエーテルは、エチルジグリコール、メチルジグリコール及びブチルジグリコールからなる群より選択される少なくとも1つの化合物を含む請求項1～3のいずれか1つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項5】

さらに、

【化1】



(式中、nは0又は1~10の整数)

で表される群より選択される少なくとも1つの界面活性剤を含む請求項1~4のいずれか1つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項6】

さらに、1~10重量%の水酸化テトラメチルアンモニウム及び3~15重量%のベンゼンジオールからなる群より選択される少なくとも1つの化合物を含む請求項1~5のいずれか1つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項7】

さらに、1~15重量%のアルキルスルホン酸を含む請求項1~6のいずれか1つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項8】

10重量%のアルカノールアミンと、45重量%のスルホキシド化合物又はスルホン化合物と、45重量%のグリコールエーテルとを含む請求項1~7のいずれか1つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。

【請求項9】

フォトレジストを剥離するためのエアナイフ工程又は浸漬法を使った單一ウェハ処理方法に適用可能である請求項1~8のいずれか1つに記載のフォトレジスト用ストリッパー組成物。